



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

RESOLUÇÃO CPGSS/PRPG Nº 035, DE 10 DE JUNHO DE 2009

Dispõe sobre os procedimentos para a realização de defesa da Dissertação ou Tese fechada junto a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, de que trata o artigo 66 do Regulamento Geral de Pós Graduação *Stricto Sensu*.

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista o preceituado no artigo 66 do Regulamento Geral de Pós-Graduação *Stricto Sensu*,

RESOLVE:

Art. 1º Para solicitar a defesa fechada da Dissertação ou Tese o coordenador do programa deverá atender a seguinte tramitação:

I – Encaminhar para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação um memorando demonstrando o interesse da defesa fechada da Tese ou Dissertação.

II – Preencher o Questionário de Invenção que estará disponível no endereço eletrônico do Núcleo de Inovação Tecnológica – NINTEC, e enviar para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

Parágrafo Único – A Pró-Reitoria de Pós-Graduação encaminhará o Questionário de Invenção devidamente preenchido para o Núcleo de Inovação Tecnológica – NINTEC, que realizará as buscas de anterioridade para averiguar a novidade da tecnologia.

Art. 2º A Pró-Reitoria de Pós-Graduação enviará para o Núcleo de Inovação Tecnológica – NINTEC/UFLA a solicitação de realização da defesa fechada

e o Questionário de Invenção para verificação de patenteabilidade através de Buscas de Anterioridade em Bancos de Depósito de Patentes.

Art. 3º O Núcleo de Inovação Tecnológica emitirá um Parecer Técnico sobre a necessidade de realização da defesa fechada.

Parágrafo Único: Será encaminhado junto com o Parecer Técnico o resultado da busca de anterioridade realizada com as informações obtidas no preenchimento do Questionário de Invenção.

Art. 4º Aprovada a realização da defesa fechada, o Núcleo de Inovação Tecnológica providenciará o Termo de Sigilo e Confidencialidade que deverá ser assinado por todos os membros da banca examinadora e pelo orientador.

Parágrafo Único: Se julgar necessário, o Núcleo de Inovação Tecnológica poderá solicitar a assinatura no Termo de Sigilo ou Confidencialidade de todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento da Tecnologia Patenteável.

Art. 5º Após a realização da defesa, o discente e/ou orientador deverá providenciar junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica a Redação da Patente que deverá ser depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI no prazo de 90 dias.

§ 1º: Decorrido os 90 dias sem a manifestação do discente e/ou seu orientador, o Núcleo de Inovação Tecnológica – NINTEC, se julgar conveniente, providenciará o depósito da patente, porém estará sujeito ao fluxo normal e as prioridades existentes no NINTEC.

§ 2º: O discente somente receberá o título após efetuado o depósito da patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, salvo nos casos em que o Núcleo de Inovação Tecnológica – NINTEC julgar não ser conveniente a proteção, caso em que a dissertação ou tese será publicada conforme disposto no Regulamento Geral da Pós Graduação *Stricto Sensu*.

§ 3º: Não sendo conveniente o depósito da patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, a dissertação ou tese deverá ser publicada conforme disposto no Regulamento Geral da Pós Graduação *Stricto Sensu*.

Art. 6º Após a realização do depósito da patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI o Núcleo de Inovação Tecnológica – NINTEC/UFLA deverá encaminhar memorando com as informações pertinentes para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para dar encaminhamento na publicação da Dissertação ou Tese.

Art. 7º Toda decisão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e dos colegiados dos programas sobre a realização da defesa fechada deverá ser precedida de um parecer prévio do Núcleo de Inovação Tecnológica – NINTEC/UFLA.

Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Inovação Tecnológica e Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

Art. 9º Esta portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Alcides Moino Junior
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação